PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-095667

(43) Date of publication of application: 04.04.2000

(51)Int.CI.

A61K 7/48 A61K 7/00

(21)Application number: 10-283418

(71)Applicant: SHISEIDO CO LTD

(22) Date of filing:

19.09.1998

(72)Inventor: TOKUE WATARU

NISHIYAMA SEIJI

(54) SKIN LOTION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a skin lotion having potent effects for preventing and improving a skin roughness by containing an extract of tea leaves and/or fruits, and a compound selected from serine, alanine, edetate, etc.

SOLUTION: This skin lotion is obtained by containing (A) 0.001-5.0 wt.%, preferably 0.01-1.0 wt.% extract of leaves and/or fruits of Thea sinensiss Linne, (B) 0.01-10.0 wt.%, preferably 0.1-5.0 wt.% ≥1 compound selected from serine, alanine, trimethylglycine, edetate, ethylenediaminehydroxyethyl triacetic acid trisodium salt. As the method for obtaining the component (A), e.g. a method for heating for refluxing a prepared material from tea leaves (a green tea) for a set period of time, filtering and then concentrating or diluting to obtain an extract, can be used. As the extracting solvent, water, a lower alcohol such as ethanol, 1,3-butylene glycol, glycerol, etc., are preferable.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

95667





実用新案登録願

昭和54年12月2

考察の名称

デイオンリニウタイロウセイギョペンソウチ 低 祖 純 休 用 制 舞 券 装 置

考案者の住所氏名

実用新案登録出願人の住所氏名

ミナトクニシシンパシ 東京都港区西新橋一丁目1

見来 株 式 会 社

代理人の住所氏名

東京都千代中区撤泊町1丁田9番16号 東不能なピルデイング内 電話(256)6469番

木 戸 (3339) 介理 出



5. 添附書類の目録

(1)明細書 1 涌(2)図而 1 涌(3)零作款 1 通(4)顧書關本 1 通

95667

54 186 137





6. 前記以外の考案者、実用新案登録出願人または代理人 (1) 考 案 者

(2) 実用新案登録出願人

(3) 代 型 人

東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 - 丸石第2ピルデイング内

(7034)

角理士 服

部

重

徳(



同所

(8170) 弁則出 鶴 若 俊 雄



95657

ř



明 細 書

1. 考案の名称

低温流体用制御弁装置

2 実用新案登録請求の範囲

95667



冷様により冷却する、熱交換器を介して前配弁の 駆動部の一室に連結する一方、前配駆動部の他室 を前記熱交換器を介してシールドガス溜に連設せ しめたことを特徴とする低温流体用制御弁装置。

2

3.考案の詳細な説明

本考案は低温液化ガス等の低温流体用制御弁機構に関するもので、更に詳しくは熱損失を低減し、配管の熱応力の解消と配管工事の単純化を可能とした低温流体用制御弁装置である。

一般に被化天然ガス,被体窒素,被体酸素等の如き低温流体の流通配管に設置する制御弁は、弁体のみが低温流体流路に設置され、該弁体を駆動する駆動部は駆動を充分確実にするため、前配弁体に連結した長い弁棒を介して常温域に設置された駆動部より弁ている。それ故常温域に設置された駆動部より弁



本考案は上述の如き現状に鑑みなされたもので、 その特徴は、駆動部を常温域に曝すことなく、か つ低温液体が流れる弁体とほぼ同じ低温度に保持 するように構成して前記従来の低温弁の不都合を

ことごとく解消した低温流体用制御弁作動装置で ある。以下本考案を図面により説明する。

4

第 / 図は本考案のダイヤフラム弁の作動機構を 例示したもので、1は駆動部、2は弁体で、これ らは隔壁3を介して一体に形成されている。4は 駆動部 1 を室 5 、6 に気密に区劃するよう設けら れたダイヤフラム、7は室5に連通する作動ガス 導出入口、8は室6に連通して設けたガス導入 9は弁棒で、その一端は前記ダイヤフラム4に連 結され、他端は前記隔盤3を貫通しかつベローズ 10の如き密封手段により気密に保持して弁体2 内に延びていると共にその先端には弁子11が設 けられている。そして前記弁棒3は駆動部1の室 3内でスプリング12で支持されており、又飲ス プリング12は、そのパネカによりダイヤフラム



4の作動を制御している。13,14は弁体2に それぞれ散けられた低温流体の流入口、流出口で ある。 1・5 は作動がス冷却用熱交換器で、該熱交 換器15には作動ガスの管路16、及び17の外、 該作動ガスを冷却するための冷却用ガスの管路1 8がそれぞれ設けられ、作動ガス管路16の一端 は駆動部1の室5に設けた作動ガス導入口7に、 又他端は弁体2に流れる流体の状態を検知して、 それぞれの状態に応じて作動ガスを供給する作動 ガス調整器19にそれぞれ連設されている。又、 管路17の一端は前記駆動部1の他の室6に設け たガス導出入口8に連結され他端はほぼ定圧に保 持されたシールドガス溜(図示せず)に連結され ている。次に管路18は管路16、および17を 流れる作動ガス温度を弁体2を流通する流体温度



6

迄冷却する冷媒の流路であり、冷媒は任意である.
が、弁体2を流通する流体の一部を使用することも可能である。



る度合に応じて弁権9を移動せしめることにより、 該弁権9の先端に設けた弁子11が弁体2内を移動し、該弁体2の流体流入口13の開展を制御する。

一方駆動部 1 のダイヤフラム 4 によつて仕切られた室 6 にある気体は、前記室 5 に導入した作動ガスがダイヤフラム 4 を押圧する結果、室 6 6 の押任する結果、室 6 6 の押任するお果、 2 4 の 9 年ではずる 1 5 に 3 年ではずる 1 5 に 3 年のが 1 7 を 1 2 を 1 2 を 1 2 を 1 3 を 1



8

したが、第2図に示す如くピストン式制御弁に於 ても同様に作動し得ることは勿論である。即ち第 2図において駆動部1のピストン104で仕切つ た室105,106をそれぞれ各室105,10 6 に設けたガス導出入口107,108を介して 前記熱交換器15の管路16,17に連通せしめ て、作動ガス調整器19よりの作動ガスを前配熱 交換器15で冷却した後駆動部1の室105に導 入する。そして該作動ガスの圧力変動に応じて、 ピストン104を摺動移動し、核ピストン104 に連結された弁棒109を介して飲弁棒109の 先端に具備した弁子111を弁体2内で移動せし めて、流体の流入口13の開度を調節し、流体の 流量を制御する。との間前記駆動部1の他方の室 106は定圧を保持するガスが満たされていて、



前記室 1 0 5 の作動 ガス圧力によるピストン 1 0 4 の移動によつて、前記室 1 0 6 のガスはガス導出入口 1 0 8 を出入りする。



10

流体温度に近い温度に維持されるので、大気よりの熱侵入による熱損失が低減する。そして更に、常に流体温度に維持されるので、本考案では弁に配管される管路は熱応力が低減される。このため、熱応用を考慮した繁雑な配管及び、そのための工事が軽減して材料費及び労力をも節減し得る等の効果を発揮する。

4.図面の簡単な説明

第 / 図はダイヤフラム式制御弁を例示した本考 案装置を説明する系統図、第 2 図はピストン式制 御弁を例示した本考案装置を説明する系統図であり る。

1 は駆動部、 2 は弁体、 3 は隔壁、 4 はダイヤフラム、 5 , 6 , 1 0 5 , 1 0 6 は室、 7 , 8 , 1 0 7 , 1 0 8 は作動ガス導出入口、 9 , 1 0 9



は弁棒、10はベローズ、11,11は弁子、 流 12はスプリング、13は低温流体入口、14は 低温流体流出口、15は冷却用熱交換器、16, 17,18は管路、19は作動ガス調整器である。

実用新案登録出顧人 日本酸素株式会社

代理人 弁理士 木 戸 傳 一郎

同 服 部 重 德

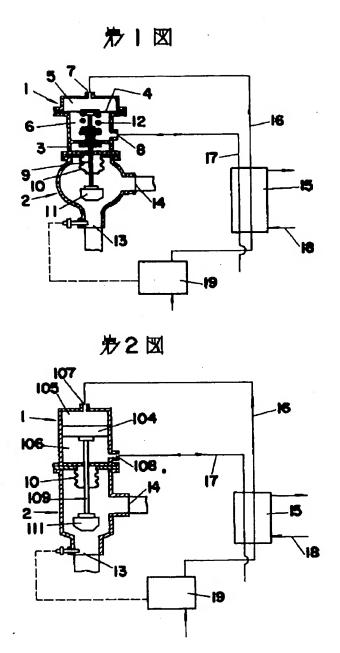
间 葡 若 俊 堆





公開実用 昭和56一 95667





代理入木户两一年十二月十二月